低温・電場中でメタン酸化カップリングに活性な Ce-W-0 系触媒の 活性酸素種の解明

Analysis of reactive oxygen species of Ce-W-O based catalyst for oxidative coupling of methane in electric field at low temperature

<u>小河 脩平 a</u>, 杉浦 圭 a, 岩崎 晃聖 a, 山中 恵介 b, 関根 泰 a Shuhei Ogo^a, Kei Sugiura^a, Kousei Iwasaki^a, Keisuke Yamanaka^b, Yasushi Sekine^a

^a 早稲田大学先進理工学研究科,^b立命館大学 SR センター ^aGraduate School of Advanced Science and Engineering, Waseda University, ^bThe SR Center, Ritsumeikan University

低温・電場中でのメタン酸化カップリングにおいて Ce₂(WO₄)₃/CeO₂触媒は高い活性を示す。この 触媒の活性酸素種を明らかにするため、電場触媒反応前後の触媒において O K 吸収端 XANES 測定 を行った。その結果、バルクの酸素種の状態は反応前後でほとんど変化しなかったが、表面におい ては電場中で酸素処理を行うことで Ce₂(WO₄)₃ 由来の酸素種が増加し、メタン処理を行うことで Ce₂(WO₄)₃ 由来の酸素種が減少した。Ce₂(WO₄)₃ 由来の酸素種が活性酸素種であると考えられる。

 $Ce_2(WO_4)_3/CeO_2$ catalyst showed high activity for oxidative coupling of methane in an electric field at low temperature. To investigate the active oxygen species, O K-edge XANES measurements were performed. Results suggested that amount of the surface $Ce_2(WO_4)_3$ species increased by O_2 treatment in the electric field whereas the surface $Ce_2(WO_4)_3$ species decreased by CH_4 treatment in the electric field, although bulk structure does not change. The oxygen species of the surface $Ce_2(WO_4)_3$ might be the active oxygen species.

Keywords: Ce-W-O catalyst, O K-edge XANES, Electric field, Methane oxidative coupling

背景と研究目的: メタン酸化カップリング はメタンからエチレンを直接製造できる高効 率なプロセスとして注目されている。メタン の活性化には高温が必要である一方で、高温 での反応においては気相酸素との非選択的・ 逐次的な反応が進行してしまうために転化率 と C2 選択率はトレードオフの関係となり, 高い C2 収率を得ることは困難であった。こ のような課題を解決するためにはメタンを低 温で活性化する手法が必要であると考えた。 我々は触媒層に数百ボルト/mm 程度の電位 を印加することで、423 K という低温におい てもメタンが転化し, エチレンなどの C2 炭 化水素が得られることを見出し[1], このため の触媒として Ce₂(WO₄)₃ を CeO₂ に担持した 触媒が高い転化率・C2 選択率を示すことを見 出した。この触媒の電場中での in-situ Raman 測定を行ったところ,電場を印加することで W-O 結合距離が長くなることが確認された。 また W L3 端 EXAFS 測定(*ex-situ*)を行った ところ, 電場中で酸素処理することで W-O 結 合距離が長くなり、その後に電場中でメタン を供給すると W-O 結合が短くなることが確 認された。このことからメタンを転化する活 性点はこれら結合距離が変化している W-O 結合の酸素原子であると考えられるが、これ まで行った分析はいずれも W から見た間接 的な酸素の情報であり、酸素の状態を直接観 測できていない。そこで、活性酸素種を明ら かにするために、種々の前処理を行った触媒 のOK 吸収端 XAS 測定を行った。

<u>実験</u>: Ce₂(WO₄)₃/CeO₂触媒(W担持量11.9 wt%)は既報に基づき調製した^[2]。(1)前処理 無し,(2)電場触媒反応後,(3)O₂+電場処理後, (4)O₂+電場処理→CH₄+電場処理後の4種類の 試料のXAFS測定を行った。標準試料として, WO₃, Ce₂(WO₄)₃, CeO₂,(NH₄)₂H₂W₁₂O₄₀, Na₂WO₄,(Bu₄N)₃PW₁₂O₄₀を用いた。空気中の 酸素による試料の酸化を防ぐために,処理後 の試料を窒素ガス雰囲気下でIn板に擦り付け, トランスファーベッセルを用いて外気に触れ させることなく装置内に試料を導入した。 立命館大学SRセンター BL-11にて,各処理 前後の試料のO K吸収端XANES測定を行っ た。測定モードは試料電流による全電子収量 法(TEY)および部分蛍光収量法(PFY)にて行 われた。

<u>結果、および、考察</u>: Fig. 1 に部分蛍光収 量法(PFY)で測定した O K 吸収端 XANES 測 定の結果を示す。各処理後の Ce₂(WO₄)₃/CeO₂ のXANES スペクトルは CeO₂のものと一致し た。これは W 担持量が少ないため,担体であ る CeO₂ の酸素種の割合が多く,バルク敏感 な PFY 法では違いが見られなかったものと 考えられる。

Fig.2には全電子収量法(TEY)で測定したO K 吸収端 XANES 測定の結果を示す。表面敏 感な TEY 法においても CeO₂ と同様のスペク トルが見られたが, 530 eV 付近のプレエッジ ピークに注目すると前処理方法の違いによっ て違いが見られた。この領域には Ce2(WO4)3 種由来のピークも重なっていると考えられる。 CeO₂由来のピークとCe₂(WO₄)₃由来のピーク の強度比(I_{Ce2(WO4)3}/I_{CeO2})を比較すると、電 場中で酸素処理をしたものは処理前と比べて ICe2(W04)3/ICe02 強度比が増加しており、その後 に電場中でメタン処理した試料は減少してい た。このことから、電場中での酸素処理後に は Ce₂(WO₄)3 種由来の酸素種が表面に多く形 成され、その後に電場中でメタン処理するこ とでその酸素種が反応して消費されているも のと考えられる。WL3 吸収端 XAFS 測定か らも電場触媒反応中における W-O 結合の消 費と再生が示唆されており,今回の OK 吸収 端 XANES 測定はその結果を支持している。

一方で,各処理後に担体である CeO₂ の酸素種の状態も変わっており,この影響で Ce₂(WO₄)₃ 上の酸素種の状態変化が見えにく くなっているものと考えられる。

今後,W 担持量を増やした試料を作製し, それぞれについて同様のテストを行うことで 電場触媒反応中における活性酸素種の状態を 詳細に調べることができると考えられる。

<u>文</u>献

[1] K. Tanaka, Y. Sekine, K. Oshima, Y. Tanaka, M. Matsukata and E. Kikuchi., Catal. Lett., 41 (2012) 351

[2] A.-S. Mamede, E. Payen, P. Grange, G. Poncelet, A. Ion, M. Alifanti and V. I. Pârvulescu, J. Catal., 223 (2004) 1

<u>論文・学会等発表(予定)</u>

[3] 小河脩平,杉浦 圭,岩崎晃聖,矢部 智宏,関根 泰,第117回触媒討論会 B(口頭 発表)

[4] 岩崎晃聖,杉浦 圭,矢部智宏,小河 脩平,関根 泰,第117回触媒討論会 A (ポス ター発表)

上記に加えて、英文学術雑誌への投稿も予定 している。







Fig. 2. O K-edge XANES Spectra (TEY)